

第3節 特許庁 .....	453
産業財産権をめぐる動向 .....	453
1. 我が国における出願と審査の動向 (2005年) .....	453
1. 1. 特許 .....	453
1. 2. 意匠 .....	453
1. 3. 商標 .....	454
1. 4. 審判 .....	454
2. 出願動向に関する国際比較 .....	454
2. 1. 特許 .....	454
2. 2. 意匠 .....	455
2. 3. 商標 .....	457
3. 企業等の知的財産活動に関する実態 .....	458
4. 大学における活発な知的財産活動 .....	459
知的財産戦略の現状と課題 .....	460
1. 我が国産業競争力の強化に向けた課題 .....	460
2. 経営戦略に沿った知的財産ポートフォリオの構築 .....	461
3. 技術分野別三極コア出願の日米欧比較 .....	462
4. 企業における特許戦略の事例 .....	462
政府における取組 .....	463
1. 知的財産保護強化のための主な施策 .....	463
2. 特許審査迅速化・効率化のための行動計画 .....	464
2. 1. 迅速的確な審査に向けた取組 .....	464
2. 2. 特許審査に関する国際協力の推進 .....	464
2. 3. 知的財産経営の推進と社内体制整備 .....	465
産業界・弁理士(会)の取組への支援 .....	466
1. 審査請求料返還制度の拡充 .....	466
2. 中小企業等に対する支援 .....	466
国際的な動向と我が国の取組 .....	467
最新の企業別出願状況 .....	468
1. 2004年における特許出願件数上位10社の特許出願件数 .....	468
2. 2005年における意匠登録件数上位10社の登録件数推移 .....	468
3. 2005年における商標登録出願件数上位10社の出願件数推移 .....	468

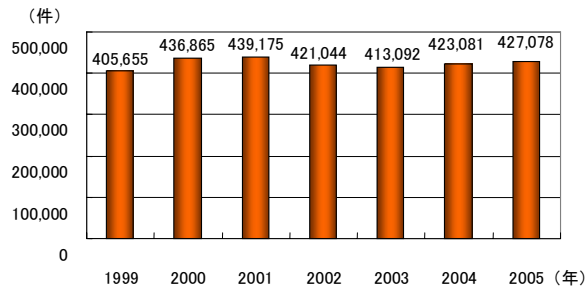
### 第3節 特許庁

#### 産業財産権をめぐる動向

##### 1. 我が国における出願と審査の動向（2005年）

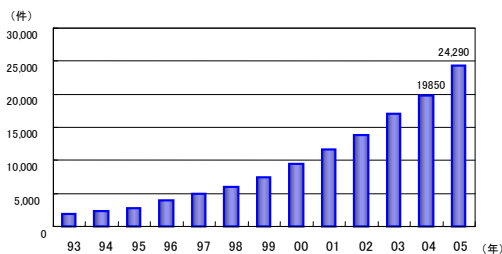
###### 1. 1. 特許

2005年の特許出願件数は、42.7万件であり（前年比1%増）、近年、40万件を超える高い水準でおおむね安定的に推移している。



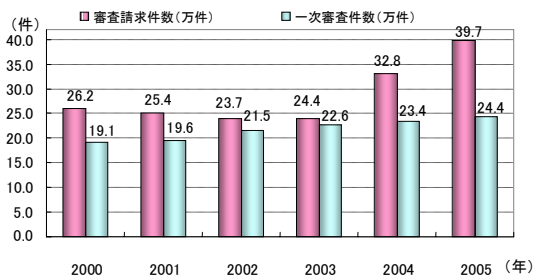
【特許出願件数】

特許協力条約に基づく国際特許出願（以下、「PCT（Patent Cooperation Treaty）出願」と略す。）の出願件数は、2.4万件（前年比22%増）と大幅に増加した。



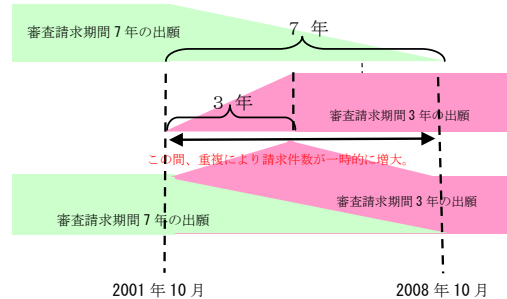
【PCT出願件数】

一次審査件数は、任期付審査官の採用や先行技術調査外注の拡大等の様々な取組を着実に実施することにより、審査体制の強化や審査の効率化が図られた結果、2001年19.6万件から2005年24.4万件へと24%増加した。



【審査請求件数と一次審査件数】

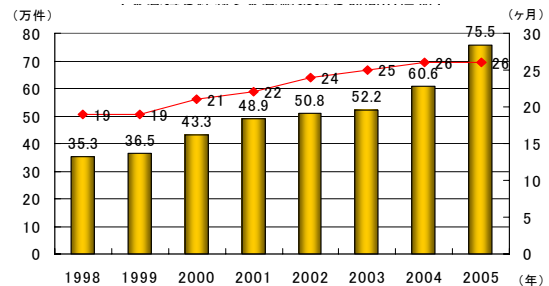
一方、2001年10月以降の出願について審査請求期間が7年から3年へ短縮されたことにより、2004年10月以降、審査請求期間3年の出願の審査請求と審査請求期間7年の出願の審査請求とが重なって、審査請求件数の一時的な増大、いわゆる「請求のコブ」が生じている。



【新旧審査請求制度の共存による審査請求急増（請求のコブ）】

この影響もあり、2005年の審査請求件数は、2004年と比べ21%増加した。

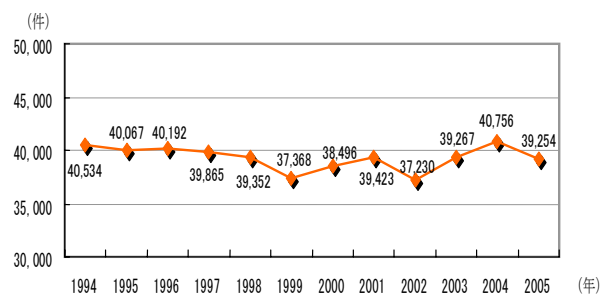
請求のコブは2008年まで続く予想されるが、審査順番待ち期間（2005年：26か月）については、若干の長期化を乗り越えて、2013年に世界最高水準の11か月に短縮することを目標としている。



【審査待ち件数と審査待ち期間】

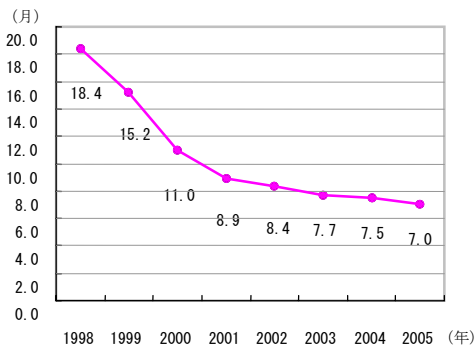
###### 1. 2. 意匠

2005年の意匠登録出願件数は、3.9万件であり、4万件前後で推移し、安定しているが、前年（4.1万件）を下回った（前年比4%減）。



【意匠登録出願件数】

2005年の意匠審査に関する一次審査件数（以下、「F A (First Action)件数」と略す。）は4.0万件であり、意匠登録出願の審査順番待ち期間（以下、「F A (First Action)期間」と略す。）は、7か月に短縮された。



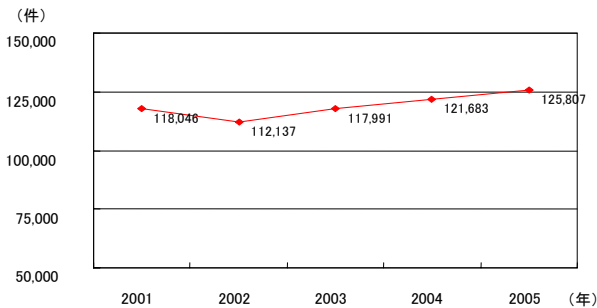
(備考) F A期間：出願から審査結果の最初の通知が發送されるまでの期間。

【意匠審査のF A期間】

### 1. 3. 商標

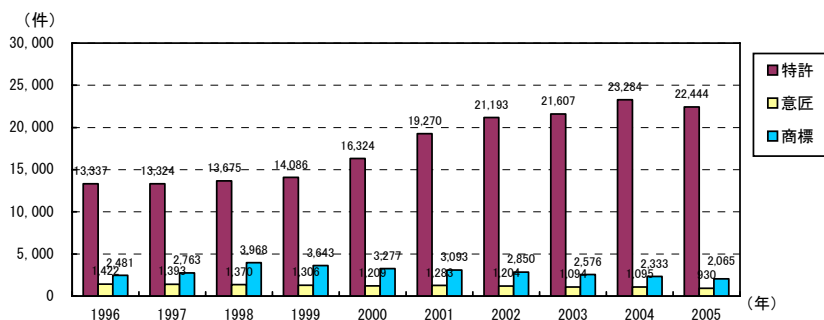
2005年の商標登録出願件数\*は12.6万件で、2004年の12.2万件と比べ3%増となっており、2002年以降、3年連続して増加傾向にある。

\*国際商標登録出願を除く。



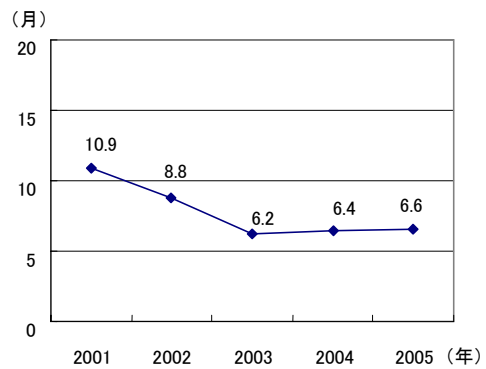
(備考) 国際商標登録出願（指定国官庁）を除く。

【商標登録出願件数】



【拒絶査定不服審判請求件数】

2005年の商標審査に関するF A件数は、12.3万件であり、F A期間は短縮化され、6か月台で推移している。



(備考) F A期間：出願から審査結果の最初の通知が發送されるまでの期間。

【商標審査のF A期間】

### 1. 4. 審判

特許の拒絶査定不服審判の請求件数は、2.2万件で、近年増加傾向である（参照図：拒絶査定不服審判請求件数）。しかし、拒絶査定件数に対する請求件数の割合である審判請求率はここ数年横ばい\*であり、拒絶査定不服審判の請求件数は拒絶査定件数におおむね連動していることがわかる。

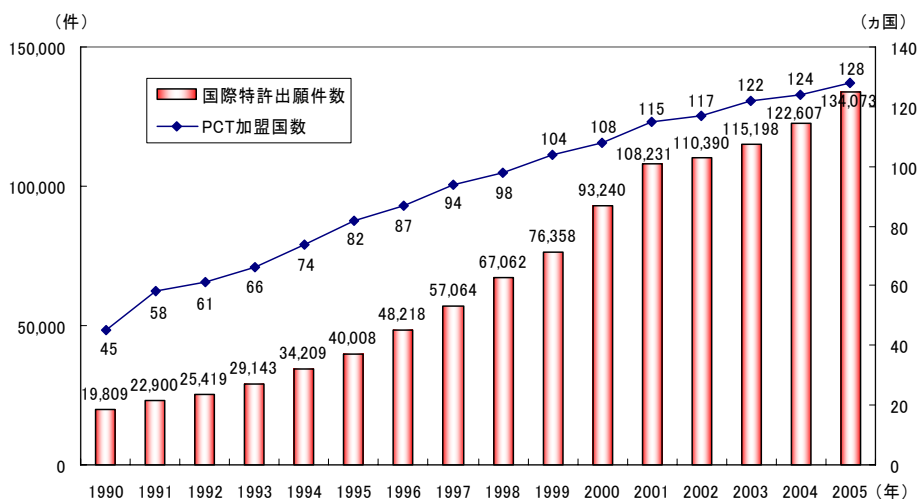
意匠、商標の拒絶査定不服審判の請求件数は、意匠0.9千件、商標2.1千件となっており、微減傾向を示している。

\*審判請求率は、2001年 23%、2002年 21%、2003年 20%、2004年 21%、2005年 21%と推移。

## 2. 出願動向に関する国際比較

### 2. 1. 特許

2005年における世界のPCT出願件数は13.4万件であり、2004年と比べ9%増加した（参照図：PCT加盟国数及び国際特許出願件数）。



【PCT加盟国数及び国際特許出願件数】

特に、日本、中国、韓国は、2桁の伸びを示し（日本24%増、中国44%増、韓国34%増）、日中韓3か国の世界のPCT出願件数に占める割合は合計で24%に達している（参照図：出願人国籍別の国際特許出願件数）。

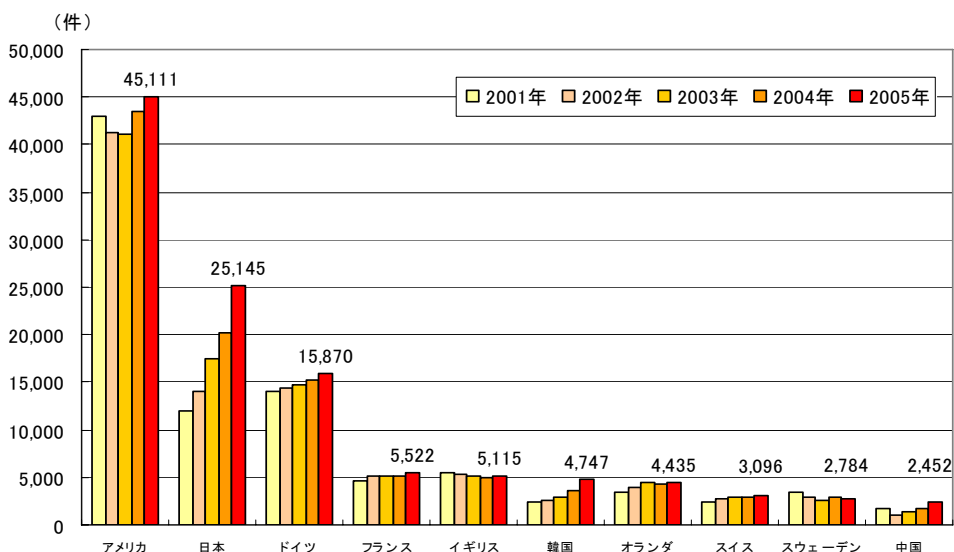
経済のグローバル化に伴い、全体的に特許出願件数が増加している中、特に中国及び韓国における特許出願件数の増加が目立つ（2005年 中国：17.3万件（前年比33%増）、韓国：15.7万件（前年比12%増））（参照図：主要国・機関における特許）。

2004年における日本人による海外（米・中・韓・欧州特許庁（以下、「EPO」（European Patent Office）と略す。）への特許出願件数について見ると、米国への出願が

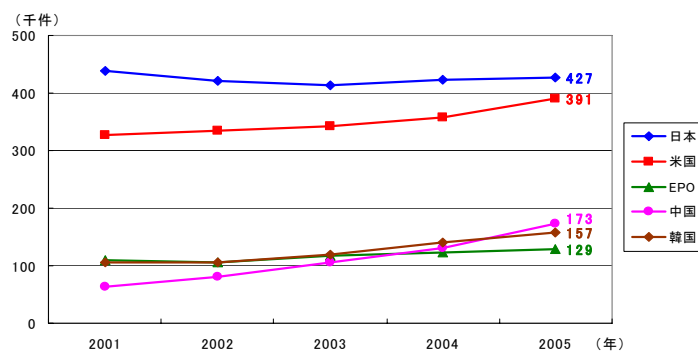
6.5万件（2004年）と、依然として最も多い。また、2004年の中国への出願は2.6万件と、2002年と比べ65%の急増となっており、2003年以降、欧州への出願を上回っている。このことから、近年の日本企業の中国重視の傾向がうかがえる（参照図：日本人による外国（主要国）への出願件数）。

## 2. 2. 意匠

無審査国である中国における意匠登録出願の増加が著しく、2005年は、2004年の11.1万件と比べ、47%の増加で我が国の約4倍に当たる16.3万件の出願がなされている（参照図：主要国・機関における意匠登録出願件数）。



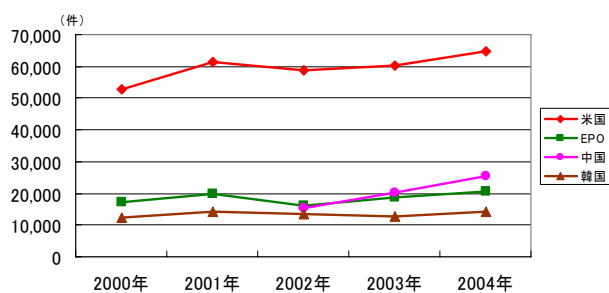
【出願人国籍別の国際特許出願件数】



(備考) 米国はUtility Patentのみを計上。

【主要国・機関における特許出願件数】

【日本人による外国（主要国）への出願件数】

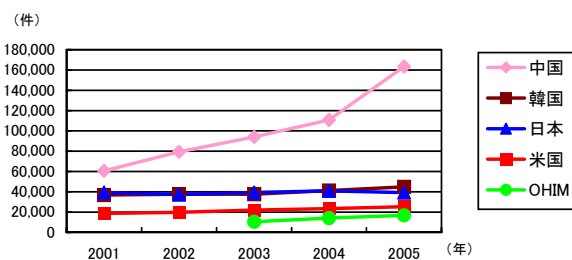


単位: 件

	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
米国	52,891	61,238	58,739	60,350	64,812
EPO	17,124	19,845	15,912	18,534	20,584
中国	-	-	15,511	20,092	25,542
韓国	12,256	14,082	13,299	12,632	14,226
4か国合計	-	-	103,461	111,608	125,164

(備考) 米国はUtility Patentのみを計上。欧州に対する件数はE P O (欧州特許庁) 分のみを計上しており、E P C加盟国の各特許庁分は含まれていない。

【主要国・機関における意匠登録出願件数】



単位: 件

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
中国	60,647	79,260	94,054	110,849	163,371
韓国	36,867	37,587	37,607	41,184	44,957
日本	39,423	37,230	39,267	40,756	39,254
米国	18,636	19,706	21,966	23,457	25,304
OHIM	-	-	10,473 (40,640)	14,031 (53,892)	16,797 (63,648)

(備考) ・米国は起算月を10月としている。

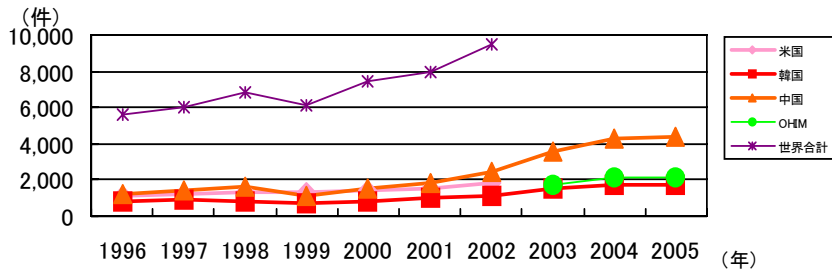
- ・OHIM: 欧州共同体商標意匠庁 (Office of Harmonization in the Internal Market) の略称。
- ・欧州共同体意匠規則ではロカルノ分類のクラスが同一の意匠は、1出願に複数意匠を出願することが認められている。(カッコ内は意匠数を示している。)

日本人による海外への意匠登録出願件数は近年増加傾向にあり、2002年の合計は9.5千件となっている。近年は米国、韓国、中国への出願件数にも増加の傾向が見られ、特に中国への出願件数の増加が著しく、2005年は、2001年と比べると約2.5倍の4.4千件となっている(参照図：日本人による海外への意匠登録出願件数)。

### 2. 3. 商標

中国における出願件数が2004年に59.0万件となり、顕著な増加傾向を示している(中国は、1出願1区分の制度を採用)(参照図：主要国・機関における商標登録出願件数)。

【日本人による海外への意匠登録出願件数】

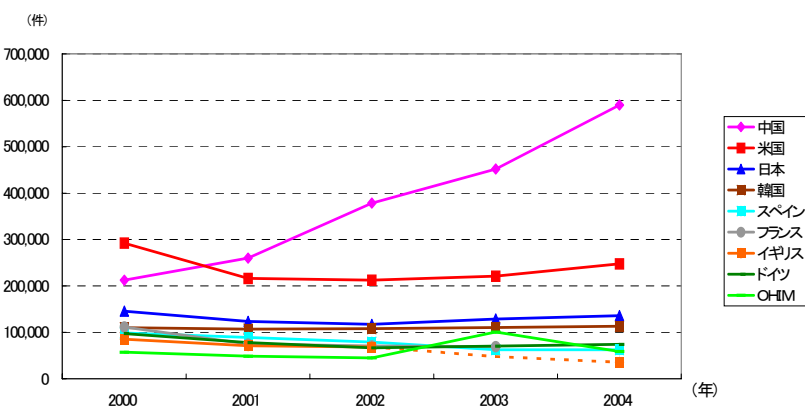


	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
中国	1,177	1,400	1,650	1,148	1,501	1,837	2,459	3,522	4,299	4,437
OHIM	-	-	-	-	-	-	-	1,711	2,152	2,168
韓国	836	875	810	680	812	981	1,131	1,558	1,746	1,718
米国	1,072	1,189	1,364	1,362	1,466	1,568	1,790	-	-	-
世界合計	5,613	6,012	6,865	6,080	7,402	7,920	9,521	-	-	-

(備考)・米国は起算月を10月としている。

- ・OHIM：欧州共同体商標意匠庁 (Office of Harmonization in the Internal Market) の略称。
- ・韓国は特定分野 (B1類 (衣類等)、C1類 (寝具、カーテン等)、F3類 (事務用紙、広告紙、転写紙等)、F4 (包装紙、ラベル、包装容器等)、M1類 (織物地、壁紙、合成樹脂地等)) は無審査である。
- ・欧州共同体意匠規則ではロカルノ分類のクラスが同一の意匠は、1出願に複数意匠を出願することが認められており、数字は意匠数を示している。

【主要国・機関における商標登録出願件数】



	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	対世界合計比 (2004年)
中国	212,602	259,924	378,631	452,095	589,655	31.9
米国	292,464	216,308	212,637	220,965	247,593	13.4
日本	145,833	123,788	117,472	128,724	135,979	7.4
韓国	110,073	107,137	107,876	110,590	113,320	6.1
ドイツ	97,337	77,877	66,645	70,446	74,197	4.0
スペイン	98,751	89,200	78,931	62,687	62,706	3.4
OHIM	57,324	48,885	45,104	100,815	58,959	3.2
イギリス	85,578	71,091	68,534	(7,928)	35,564	1.9
フランス	111,792	74,837	70,809	69,410	(8,100)	-
世界合計	2,169,105	1,809,679	1,851,723	1,442,376	1,846,982	100.0

(備考)・OHIM：欧州共同体商標意匠庁 (Office of Harmonization in the Internal Market) の略称。

2002 年における日本人による海外への商標登録出願の合計は 2001 年とほぼ同数であるが、中国への出願が最も多く、2001 年の 4.3 千件から 8.3 千件へとほぼ倍増している(参照図:日本人による外国への商標登録出願件数)。

### 3. 企業等の知的財産活動に関する実態

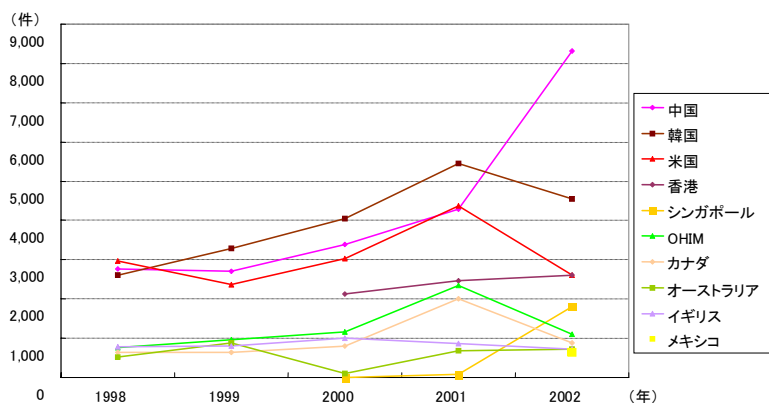
2004 年度の我が国企業等の知的財産活動費は、知的財産担当者数の増加、外国への特許出願件数の増加に加え、特許審査請求件数の急激な増加等の影響により、約 9,200 億円となっており、2003 年度から 17%増加している(参

照図:知的財産活動費)。

2003 年度から 2004 年度における特許の利用状況は、利用件数と未利用件数の割合がほぼ同程度(約 48%)で推移している。

1995 年度には、大企業が保有する特許の約 33%が利用、約 67%が未利用であったことにかんがみれば、単純には比較できないものの、特許の利用率はこの 10 年で着実に伸びてきている(参照図:国内における特許所有件数及びその利用率)。

【日本人による海外への商標登録出願件数】

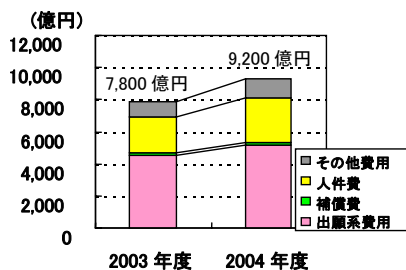


単位: 件

	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年
中国	2,773	2,698	3,395	4,296	8,314
韓国	2,611	3,284	4,052	5,455	4,543
米国	2,971	2,374	3,027	4,370	2,607
香港	-	-	2,131	2,469	2,598
シンガポール	-	-	4	82	1,805
OHIM	769	955	1,161	2,333	1,098
カナダ	634	650	810	1,996	890
オーストラリア	526	878	101	674	716
イギリス	788	798	995	853	715
メキシコ	-	-	-	-	640
世界合計	20,233	21,427	27,025	31,949	31,084

(備考)・OHIM: 欧州共同体商標意匠庁 (Office of Harmonization in the Internal Market) の略称。

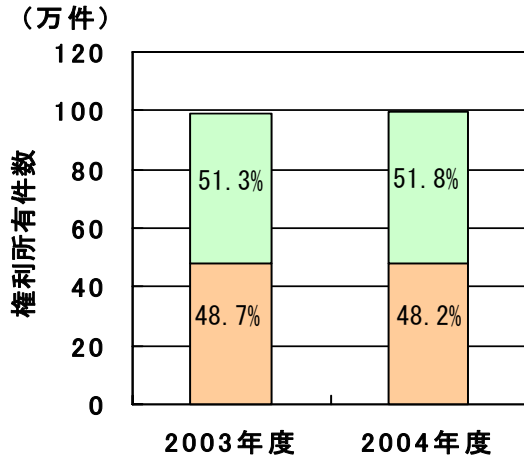
【知的財産活動費】



	知的財産活動費(百万円)		活動費の増減率
	2003年度	2004年度	
全体	782,886	916,590	17.1%
出願系費用	452,877	517,590	14.3%
補償費	13,080	14,655	12.0%
人件費	221,343	262,530	18.6%
その他費用	95,586	121,815	27.4%

- 出願系費用: 産業財産権の発掘から権利取得、権利の維持に要した費用(弁理士費用等の外注費を含む)を指す。
- 補償費: 会社の定める補償制度に基づいて発明者、創作者等に支払った補償費を指す。
- 人件費: 社内で知的財産業務を担当する者の直近の会計年度総額を指す。
- その他費用: 上記の3つに含まれない費用(知財にかかる係争事務、契約管理、企画、調査、教育に要した費用等)を指す。

【国内における特許権所有件数及びその利用率】



	国内権利	
	2003年度	2004年度
特許権所有件数	990,272	996,417
うち利用件数	482,746	480,421
うち未利用件数	507,526	515,996

出願件数階級別特許権所有件数及び利用率(回答の単純集計)

	標本数	所有件数 (件)	うち利用件数 (件)	利用率	
企業	10件未満	855	7,382	4,539	61.5%
	10～50件未満	710	40,814	20,298	49.7%
	50～100件未満	137	23,212	9,513	41.0%
	100件以上	189	162,105	70,079	43.2%
大学等	151	7,709	1,825	23.7%	

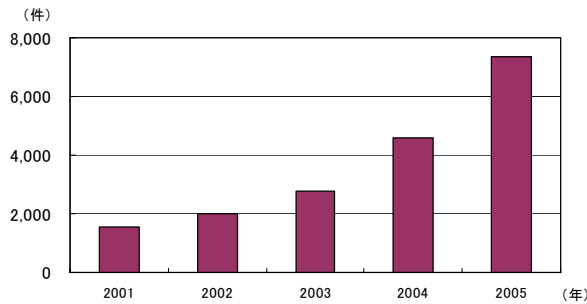
しかしながら、企業等における知的財産活動費が増加している中、依然として約半分の特許権が利用されておらず、知的財産活動費の効率的な投資という観点からも、企業等における出願戦略、権利の活用戦略等を含む知的財産戦略の策定、これに基づいた知的財産活動が必要である。

受けた技術移転事業者 (Technology Licensing Organization) (以下、「承認TLO」と略す。) の出願件数は年々増加しており、2005年の出願件数は7.4千件と、2004年の4.6千件から大幅に増加した(前年比60%増加。参照図:我が国の大学・承認TLOからの特許出願件数)。

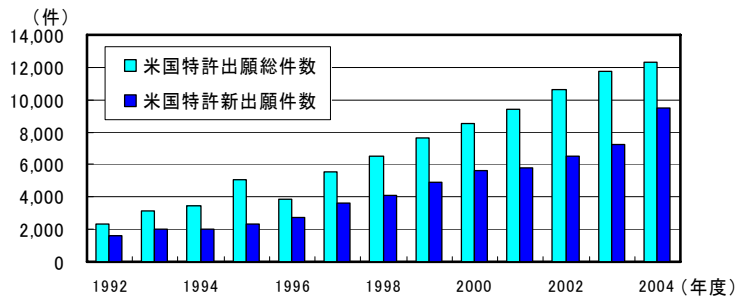
4. 大学における活発な知的財産活動

我が国の大学と大学等技術移転促進法に基づき、文部科学省、及び経済産業省より、その事業計画に対する承認を

今後は、特許性だけでなく活用も見据えた出願戦略を構築するとともに、重要な発明に関しては海外でも積極的に権利化を図っていく等、更なる戦略的な特許管理を図っていくことが重要である。



【我が国の大学・承認TLOからの特許出願件数】



(出典) AUTM Licensing Survey

なお、米国特許新出願には、継続出願、分割出願、再発行出願及び一般的には部分一部継続出願は含まれない(一部部分継続出願は新規事項が追加されている場合には新規とみなされる)。

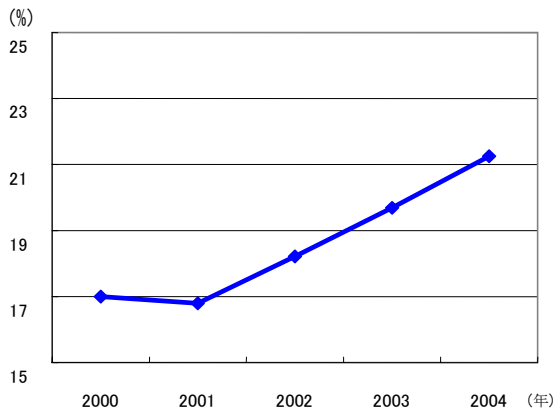
(参考) 【米国の大学からの米国特許出願件数】



## 知的財産戦略の現状と課題

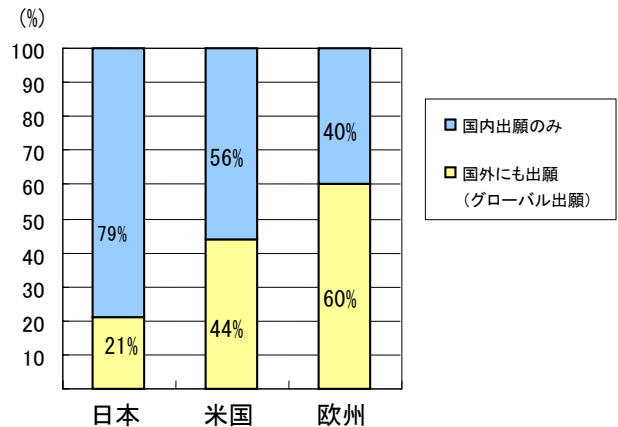
### 1. 我が国産業競争力の強化に向けた課題

企業活動のグローバル化を背景に、日本企業が国内特許出願のうち海外にも出願する比率（以下、「グローバル出願率」と略す。）は年々増加しているが（2004年21%）、欧米と比較するとまだまだ低く（米国44%、欧州60%）、国際的に見て国内特許出願に偏重していることがうかがえる。



（備考）特許庁データ。国内出願に基づかず、直接日本特許庁に出願された特許協力条約（PCT）に基づく国際出願を含む。

#### 【我が国出願人のグローバル出願率】



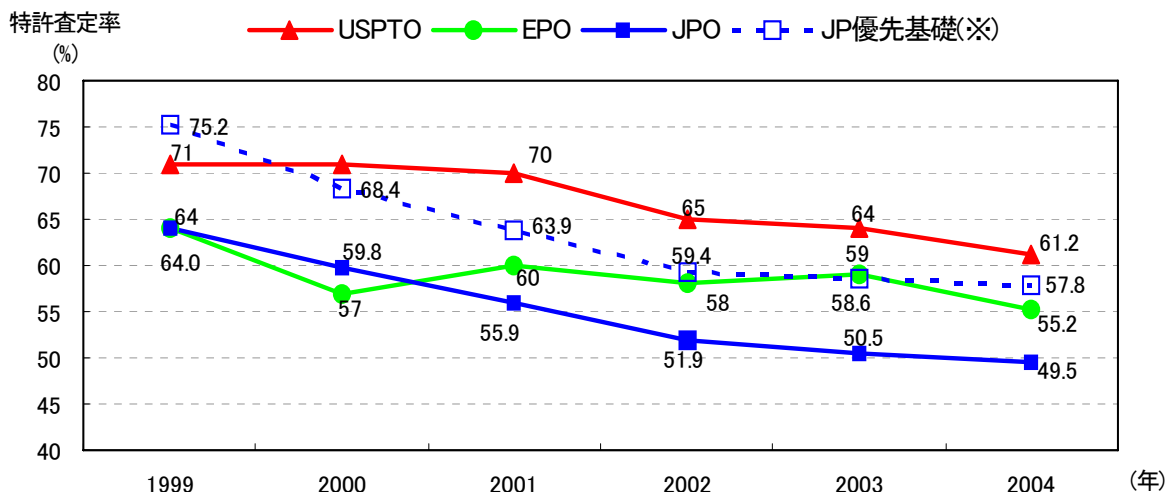
（備考）

日本：2004年出願（特許庁データ）、国内出願に基づかず、直接日本特許庁に出願された特許協力条約（PCT）に基づく国際出願を含む。

欧米：2002年優先基礎出願のWPI（World Patents Index）データ（公開された出願件数データ）。

#### 【日米欧出願人の自国特許庁への特許出願構造】

日本企業の海外特許出願の基礎となった出願の特許査定率は、57.8%と全出願の特許査定率よりも約8%程度高い値を示しており、海外へも出願する案件は、事前に十分な先行技術調査や事業性の検討がなされていることが考えられる（参照図：日米欧三極特許庁における特許査定率）。



（備考）JP優先基礎とはパリ優先権を主張して外国へ特許出願をする際に基礎となった日本国特許庁への国内特許出願のことを指す。

USPTO：米国特許商標庁（The United States Patent and Trademark Office）の略称。

#### 【日米欧三極特許庁における特許査定率】

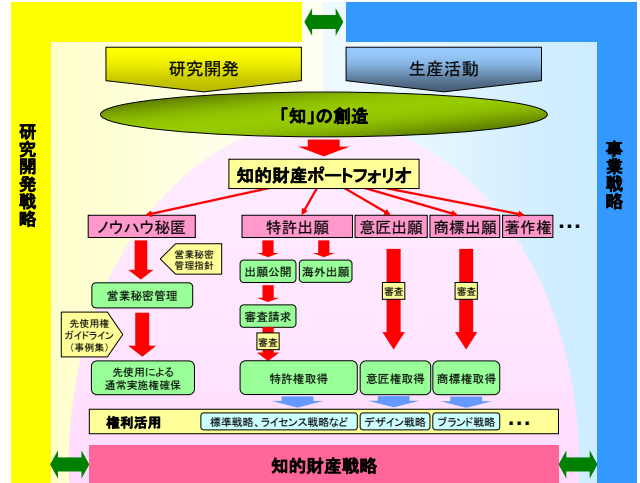
海外においても特許権の取得がなされない場合には意図せざる技術流出が懸念されることや、模倣品対策、海外での事業展開、ライセンス戦略等、様々な観点からも、海外での特許権取得や日本国内への出願戦略を更なるグローバルな視野から内外一貫性を持たせて立案・遂行することが求められる。

例えば、内視鏡に関する出願は、1990年頃より米国出願人や欧州出願人による出願が徐々に増加しているものの、世界的に見て日本出願人による出願が圧倒的に多く、日本が優位であるといえる(参照図:内視鏡分野における出願件数構成比率(1971~2003年))。

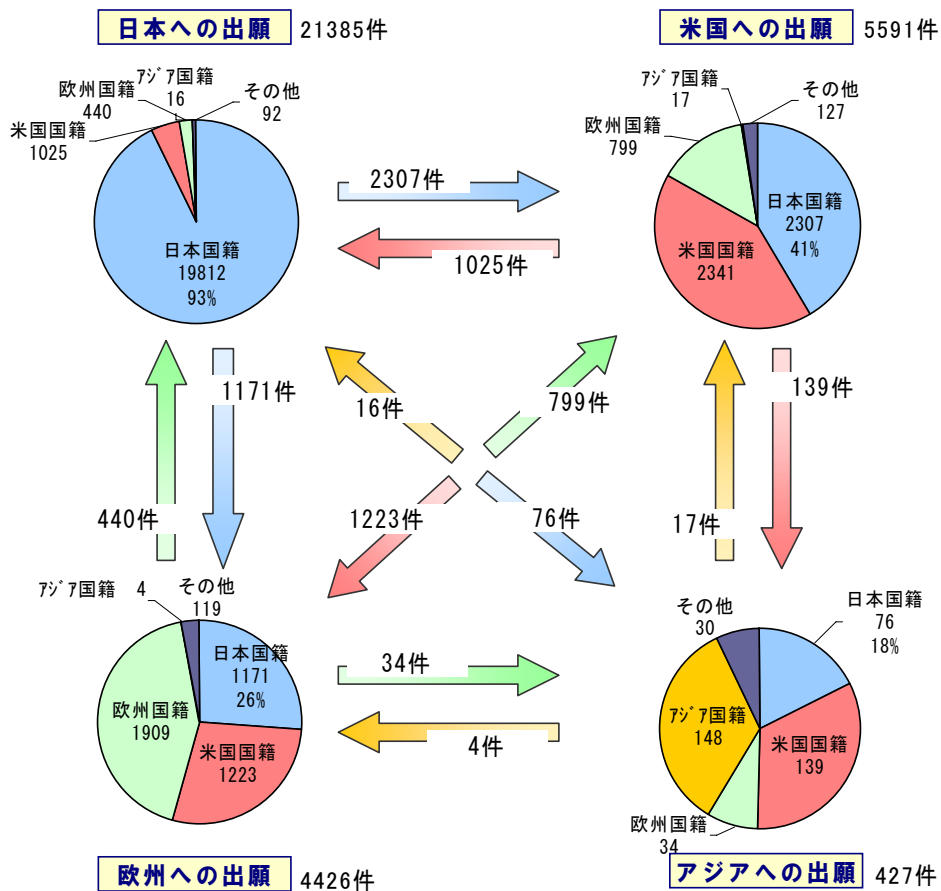
しかし、日本出願人は、欧米に対しては積極的に出願しているものの、アジアに対しては、米国出願人に遅れをとっており、また、アジア出願人自身による出願も増えてきていることから、日本としては、アジアへの出願戦略を強化する必要がある。

## 2. 経営戦略に沿った知的財産ポートフォリオの構築

企業においては、社内から生み出される無形の「知」を保護し、これを経営に十分かつ効率的に活かすには、経営戦略に沿って保護手段を使い分ける知的財産ポートフォリオの構築が有効である。



【知的財産ポートフォリオの構築】



【内視鏡分野における出願件数構成比率(1971~2003年)】

秘密にすることにより他社は類推することができず、長期間にわたり同様の製品を製造することができないような技術情報は、ノウハウとして秘匿管理することを選択し、特許出願を慎重に行うことも検討すべきである。

そして、ノウハウ秘匿を行う場合には不正競争防止法による適切な保護を受けられるように、各企業における営業秘密の管理の指針に則った管理を進めるとともに、特に事業化技術に関しては、他者による特許取得も想定し、先使用による通常実施権を確保するために必要な証拠を残す等の対策が重要である。

また、特許出願等を選択した場合には、国際的視野に立って、生産拠点や市場の動向、競合・追従企業の存在等を踏まえ、海外にも積極的に出願し、海外における特許権を取得していくことが重要である。

上記のような知的財産管理を円滑に推進するため、一元的に管理を行うことはもとより、ノウハウとして秘匿するか、特許出願をするかの峻別の手法をマニュアル化したり、結果として出願しなかったノウハウに関しても、従業員との関係で職務発明規程における発明補償の対象にするなどの体制整備を進めることが重要である。

### 3. 技術分野別三極コア出願の日米欧比較

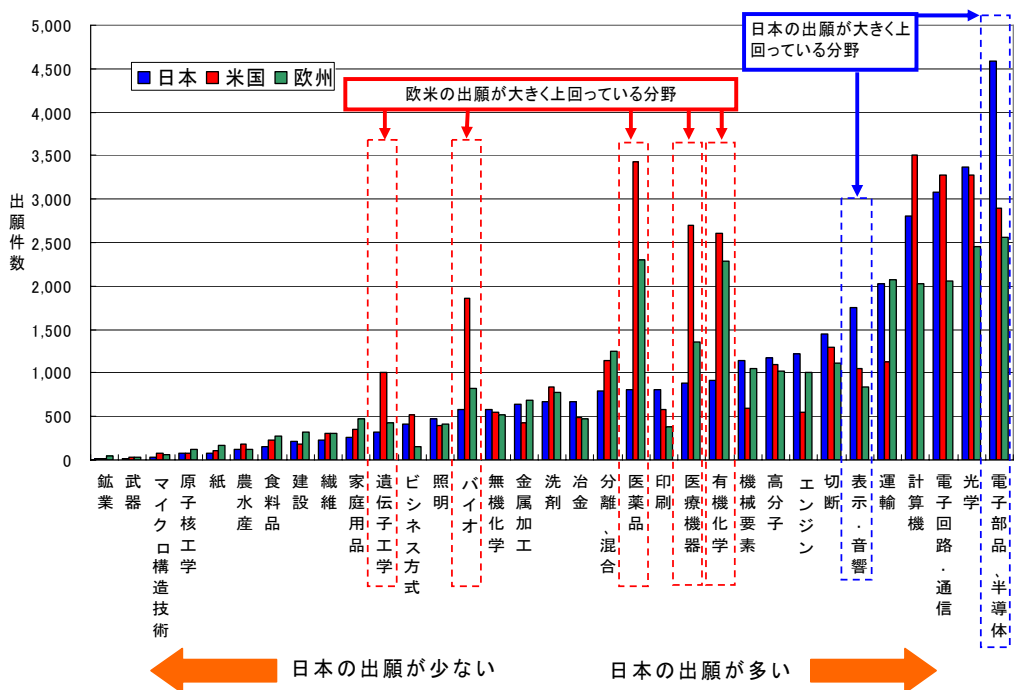
経済活動のグローバル化の進展により、重要な発明は国内だけではなく、外国にも出願される。グローバルな権利取得へ向けた取組を測る指標として、日米欧いずれかの国になされた特許出願であって、その出願を優先権の基礎にして他の二極の両方へ出願がなされたもの（三極のいずれにも出された出願）を「三極コア出願」と定義し、その構造や動向の分析を行った。

2001年（優先権主張年）における技術分野別の三極コア出願件数を出願人国籍別に見ると、「電子部品、半導体」、「表示、音響」等の分野で日本国籍の出願件数が欧米の出願件数を上回っており、反対に「遺伝子工学」、「バイオ」、「医薬品」等の分野で欧米が日本を大きく上回っている。この傾向は、2000年（優先権主張年）と同様である（参照図：日米欧の技術分野別三極コア出願件数（2001年））。

### 4. 企業における特許戦略の事例

海外特許戦略を構築する上で参考となる情報を提供すべく、海外特許戦略の成功事例・失敗事例を2社について次に掲載する。

ノウハウ秘匿を選択する上で参考となる情報を提供すべく、ノウハウ秘匿を選択した企業の実例を2社について次に掲載する。



(備考) 複数の分野にまたがる出願については重複して集計している。

【日米欧の技術分野別三極コア出願件数（2001年）】

## ○企業における海外特許戦略の成功事例・失敗事例

### 企業A ～欧米特許戦略の成功から、アジア特許戦略の失敗へ～

- (1) 1980年代、ある家電製品に関する一連の特許を日米欧で取得していたことにより、国内外の製造企業から継続的にライセンス収入を得ることに成功し、当時としては、欧米にも上手く出願して特許を取得していたことについて、社内で評価を得ていた。
- (2) その後、1990年代になり、生産拠点がマレーシア、インドネシア、中国等アジアで拡大していった。ところが、アジア諸国における特許制度運用上の問題（出願審査遅延や権利行使の難しさ等）もあり、アジア諸国には積極的に特許出願はしていなかったため、競合他社が、アジアの特許非存続国で自由に生産・販売する事態を招いてしまった。その結果、仮にアジア諸国でも積極的に特許出願していたら容易に推進できていたであろうライセンス交渉が困難を極めることとなり、アジアへの知的財産戦略が見直される契機となった。
- (3) 特許権は、特許出願から20年という長きにわたるため、特許出願の際には、その後の20年間の生産拠点や市場を予測して出願国を決めることの重要性を痛感した。

### 企業B ～中国での誤った特許戦略が、デッドコピーの蔓延を招いた～

- (1) 海外出願する場合、他社製品との差別化のポイント（技術）のみを出願するという戦略をとっていたため、ある製品について、差別化の程度が低い「構造」に関する出願はせず、制御関係だけしか出願していなかった。しかし、制御関係は、模倣されても発見が困難であり、結果として「使えない」特許しか取得できていなかった。
- (2) そのため、中国においてデッドコピー製品が出回ったときに、機械的な構造等、差止めにも有効な特許がなく、差止めが困難だった。その経験を踏まえ、模倣品対策のために必要な技術についても海外出願するようにした。
- (3) また、現地生産、現地販売を基本としていたため、商標については、海外ではそれぞれの国での現地語の商標しか取得していなかった。そうしたところ、第三者が企業Gの日本語表記の商標を中国で取得し、ビジネスを始めてしまった。そのため、企業Gは中国から日本へ自社製品の輸出に当たり、日本語表記の商標を中国の生産地で製品や外箱に付すことができなかった。現在は、海外でも日本語表記も含め幅広く商標の取得を進めている。

## ○ノウハウ秘匿を選択した企業の実例

### 企業例1（化学系企業）

#### ノウハウ秘匿を選択するポイント

他社の独自開発が困難な技術。

#### DVDと公証制度利用

工場のラインの映像や事業開始決定書などをDVDに保存し、これを入れた封筒に確定日付を取得。

#### 事実実験公正証書

最重要のノウハウについては、弁護士や弁理士を立会人として公証人に事実実験公正証書の作成を依頼。

### 企業例2（機械系中小企業）

#### ノウハウ秘匿を選択するポイント

加工方法など、製品から発明内容が漏れないこと。

#### 証拠確保

技術部が作成の作業指示書と、現場が行った試行錯誤の成果を記載した作業履歴書をセットにして公証人役場で確定日付を取得。

#### 工場の主要なところは見せない

顧客に対しても製造ラインの見学を厳しく制限。

## 政府における取組

### 1. 知的財産保護強化のための主な施策

技術開発の成果を速やかに権利化するためには、特許審査を迅速化する必要がある。審査官の確保、先行技術調査の外注拡大等によって迅速化を推進し、2005年現在26か月の審査順番待ち時間を2013年に11か月に短縮して世界最速の特許審査を実現し、最終的にはゼロにすることを目指している。

知的財産保護のためには、国内のみならず世界市場を見据えた施策を実現していく必要がある。現在、国際的な権利取得を容易なものにしていくことが重要な課題である

として、主要国との間で、第1国で特許となった出願が第2国で早期に審査を受けられることを可能とする「特許審査ハイウェイ」を推進していく。

海外との関係では模倣品対策や技術流出防止のための制度整備が求められており、被害発生国に対し、取締り強化の要請及び執行能力の向上に資する協力を行うとともに「模倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）」の早期実現を目指している。

## 2. 特許審査迅速化・効率化のための行動計画

2005年12月22日に二階経済産業大臣（当時）を本部長とする「特許審査迅速化・効率化推進本部」が設置された。

【特許審査迅速化・効率化推進本部の構成】	
本部長	経済産業大臣
副本部長	経済産業副大臣、経済産業大臣政務官、経済産業事務次官、特許庁長官
本部員	大臣官房長、総括審議官、経済産業政策局長、地域経済産業審議官、通商政策局長、産業技術環境局長、製造産業局長、商務情報政策局長、資源エネルギー庁長官、中小企業庁長官

2006年1月17日に「審査当局による取組」、「産業界等による取組」、「産業界・弁理士（会）の取組への支援」、「中小企業に対する配慮」を柱とする「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」が決定され、経済産業省が一体となって、出願人の協力も仰ぎながら、速やかに所要の対策に取り組むこととなった（参照図：特許審査迅速化・効率化のための行動計画の概要）。

## 2. 1. 迅速的確な審査に向けた取組

審査能力の強化のため、審査に従事する時間を最大限確保することや、審査官の大幅増員等の取組を行っている。

先行技術調査の外注の拡充や、調査の質を担保し、審査効率の向上を進めるため、対話型外注\*を推進している

（参照図：特許審査官の増員状況、サーチ外注件数（実績））。

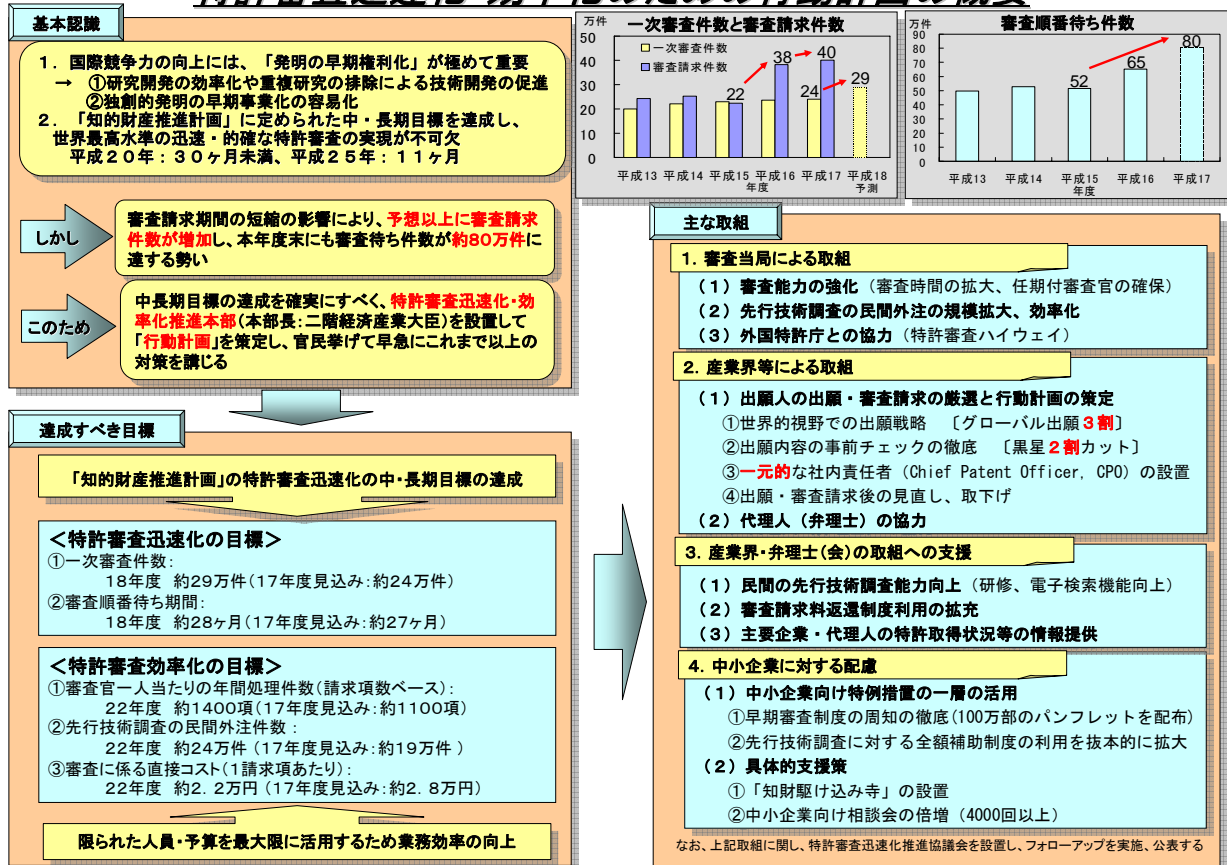
\*調査を行った者が審査官に対面で説明し、その場で審査官から追加の調査等のフィードバックを受ける形式の先行技術調査外注。

## 2. 2. 特許審査に関する国際協力の推進

「特許審査ハイウェイ」\*構想を提案し、日米特許庁間で本格的な実施に先立ち試行することに合意し、2006年7月より試行が開始される予定である。

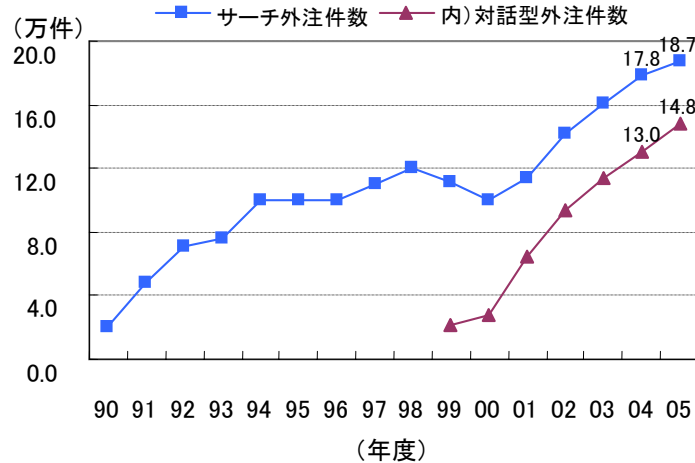
\*自国で特許になった場合に、出願人が、出願している他国特許庁に自国特許庁の審査経過書類等を提出することにより、簡易な手続で早期審査を受けることができるようにする仕組み。

# 特許審査迅速化・効率化のための行動計画の概要

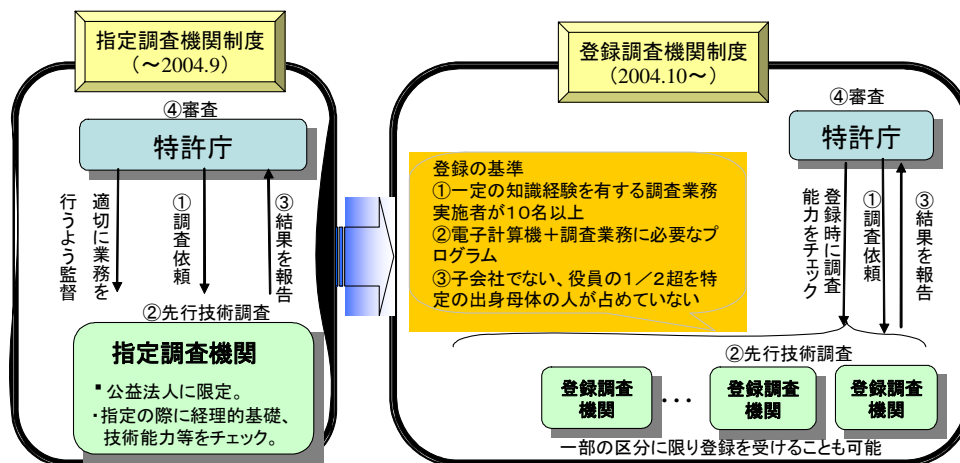


【特許審査官の増員状況】

(年度)	2004	2005	2006
通常審査官	1145 (+19)	1162 (+17)	1174 (+12)
任期付審査官	98 (+98)	196 (+98)	294 (+98)
合計	1243 (+117)	1358 (+115)	1468 (+110)



【サーチ外件数 (実績)】



登録調査機関

- ・財団法人工業所有権協力センター(IPCC)(2004年10月1日登録、調査業務実施者数1312名(2006.04時点))
  - :分類付与を含む全区分
- ・テクノサーチ株式会社(2005年3月11日登録、調査業務実施者数53名(2006.04時点))
  - :区分:動力機械(内燃機関の制御等)、運輸(自動車の構造等)、一般機械(継手、クラッチ、ブレーキ等)
- ・社団法人化学情報協会(2005年3月11日登録、調査業務実施者数13名(2006.04時点))
  - :区分:有機化合物(有機化合物・医薬(構造式)等) ※当該区分はCAS検索も求められる。
- ・株式会社技術トランスファーサービス(2006年6月5日登録、調査業務実施者数11名(登録時))
  - :区分:アミューズメント(パチンコ・スロットマシン等)

2. 3. 知的財産経営の推進と社内体制整備

企業における知的財産戦略を進めて行くために、経営トップ自らが知的財産を重視した経営方針を明確化し、その経営方針に基づいた知的財産戦略を策定し、責任ある実行に向けた体制整備を行うことが重要といえる。

そして、知的財産管理部門は広範な視野をもって全社的

な経営戦略や方針などの決定に対し、積極的かつ機動的に関与することが重要であり、全社的な知的財産戦略の実行責任者としてCPO (Chief Patent Officer: 最高特許責任者) あるいはCIPO (Chief Intellectual Property Officer: 最高知的財産責任者) を定め、知的財産関連予算や権利取得に係る権限を一元化することも重要である。

さらに、企業価値を高める I R (Investor Relations : 投資家向け広報) の観点から、企業の知的財産戦略やその活動・成果を知的財産報告書や有価証券報告書等へ戦略的に開示していくことや、知的財産関連情報の集積・分析活動を事業部や社内カンパニーの垣根を越えて統括的に推進することが企業の知的財産管理セクションに期待される (参照図 : 先行技術調査・審査結果の相互利用に関する取組の概要)。

## 産業界・弁理士 (会) の取組への支援

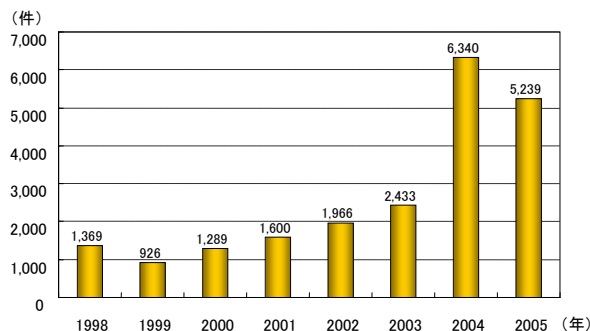
### 1. 審査請求料返還制度の拡充

2004 年 4 月より、審査請求をした後、一次審査前に出願の取下げ・放棄を行い、6 か月以内に審査請求料の返還請求を行うと、料金の一部 (半額) が返還される制度が施行された。

制度導入前は、1 千～2 千件前後で推移していた審査請求後一次審査前における取下げ・放棄の件数が、制度導入後である 2004 年以降は、5 千件を超えるようになったことから、本制度の導入により、審査請求後においても権利化の必要性について見直すインセンティブが働くようになったと考えられる。

また、2006 年 8 月 9 日から 1 年間の期限で導入される

予定の一次審査前に取下げ・放棄が行われた出願に対する審査請求料の全額返還制度により、審査請求後の権利化の必要性についての見直しが一層進むことが期待される。



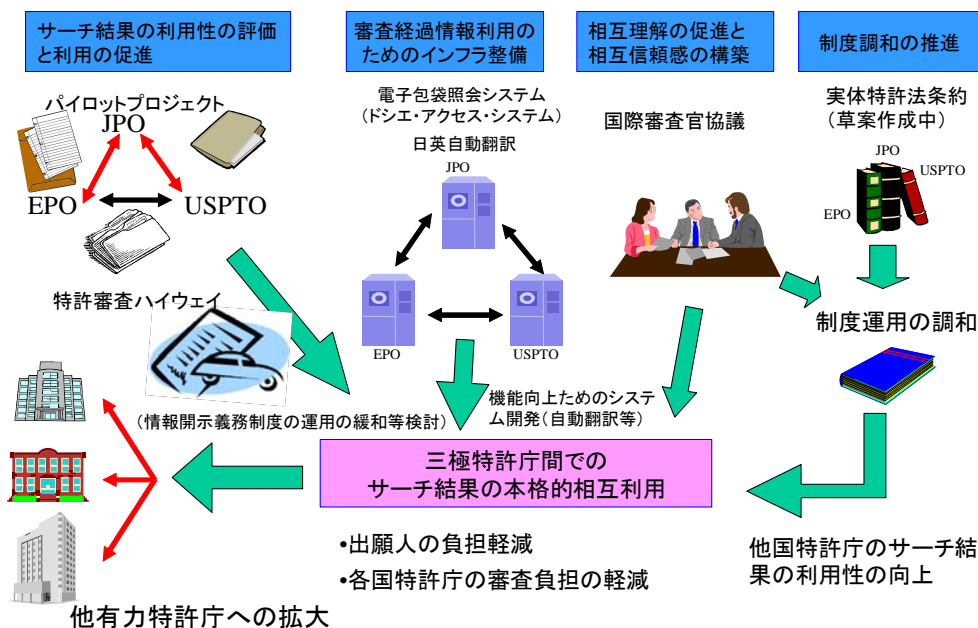
【審査請求後一次審査前における取下げ・放棄】

### 2. 中小企業等に対する支援

中小企業においても知的財産は極めて重要な役割を果たすことから、特に知的財産に関する経験が浅い中小企業に対し、「知財駆け込み寺」の設置や中小企業向け説明会の実施など支援策を拡充するなど十分な配慮を行っている (参照図 : 中小企業等に対する総合的な支援の概要)。

2000 年 1 月から資力に乏しい中小企業を対象に、審査請求料の軽減の措置及び特許料 (第 1 年分から第 3 年分) の 3 年間猶予の措置を要件に応じて適用してきたところである。

## 先行技術調査・審査結果の相互利用に関する取組の概要

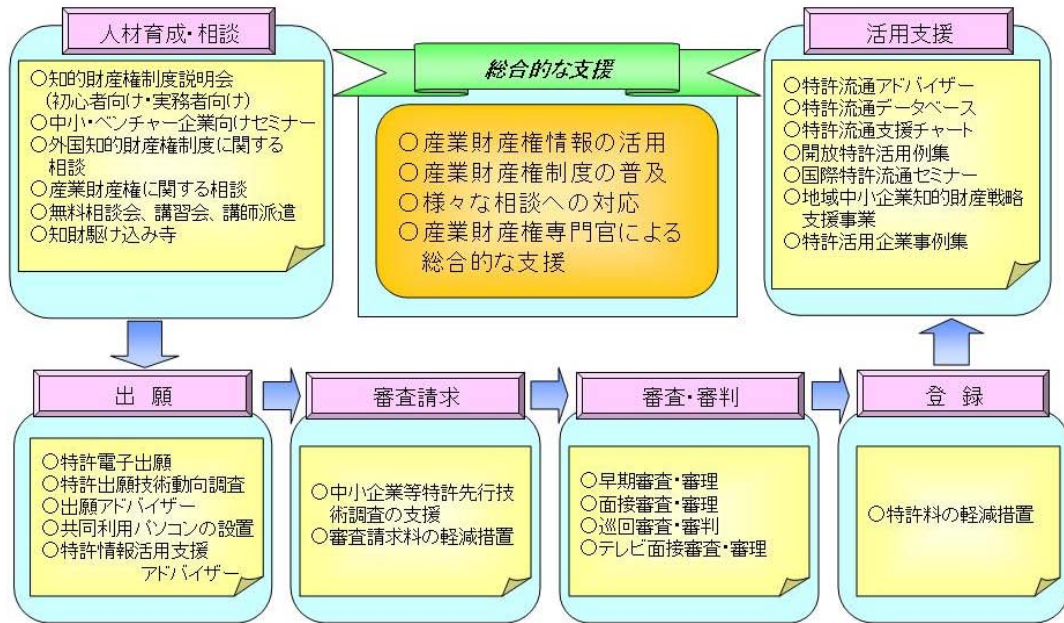


(備考) J P O : 日本特許庁 (Japan Patent Office) の略称。

E P O : 欧州特許庁 (European Patent Office) の略称。

U S P T O : 米国特許商標庁 (The United States Patent and Trademark Office) の略称。

## 中小企業等に対する総合的な支援の概要



### 国際的な動向と我が国の取組

世界知的所有権機関（以下、「W I P O」（World Intellectual Property Organization）と略す。）における特許制度の実体的調和に向けた議論が南北対立により停滞する中、議論を前進させるべく先進国会合が開催されている。2006年9月の先進国全体会合においては、4項目（先行技術の定義、グレースピリオド、新規性、進歩性）の合意を目指している。

PCT出願受理件数の80%以上を占める日米欧の三極特許庁は共通する課題を解決するため協力活動を行っている。三極特許庁会合及び三極専門家会合において、相互利用等による審査協力、出願人の手続負担軽減のための取組、制度・運用の調和に向けた取組等に関し議論が行われた。

2国間、多国間等の様々な枠組みを効果的に活用し、ア

ジア諸国における知的財産権の保護水準の向上に向けた制度の導入や運用の強化を要請するとともに、その実現に必要な体制整備のため、人材育成や情報化に対する支援を行っている。

模倣品問題の深刻化を踏まえ、[1]官民合同ミッションの派遣や2国間協議を通じた相手国政府の模倣品対策強化の要請と協力、[2]「模倣被害調査報告書」の作成等の模倣品対策に必要な情報の収集・提供、[3]「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」の実施による啓発活動等（参照図：「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」ポスター）を行っている。



「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」ポスター



## 最新の企業別出願状況

### 1. 2004年における特許出願件数上位10社の特許出願件数

		特許出願件数 (2004年)	グローバル出願率* (%) (2004年)	特許査定率* (%) (2005年)
1	松下電器産業株式会社	17,145	26.2	46.7
2	キヤノン株式会社	11,098	26.3	51.6
3	セイコーエプソン株式会社	8,542	27.0	49.9
4	株式会社東芝	7,016	33.8	51.5
5	ソニー株式会社	6,852	27.4	43.5
6	株式会社リコー	6,415	21.4	40.4
7	富士写真フイルム株式会社	6,315	35.5	53.3
8	トヨタ自動車株式会社	6,110	15.6	66.6
9	シャープ株式会社	5,816	23.3	52.7
10	株式会社日立製作所	4,678	34.1	50.0

\*グローバル出願率：

当該年に日本国特許庁になされた特許出願のうち、外国に出願されるものの割合。よって、同じ発明を複数の国に出願しても増加しない。また、グローバル出願率には、国内出願を経由せず、直接に国際出願の受理官庁としての日本国特許庁へ出願されたPCT出願も含む。この値によって、我が国で生み出された技術のうち、どの程度の割合のものが、海外での特許権取得が目指されるかの目安になる。

\*特許査定率：

1年間に特許庁の審査段階において得られた処分結果のうち、特許となる決定（特許査定）がなされた割合。

### 2. 2005年における意匠登録件数上位10社の登録件数推移

		2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
1	松下電器産業株式会社	1,188	1,278	1,290	1,031	1,079
2	シャープ株式会社	637	477	524	554	526
3	三洋電機株式会社	612	578	670	590	434
4	松下電工株式会社	553	408	422	396	398
5	株式会社東芝	498	474	406	297	387
6	株式会社岡村製作所	319	322	338	314	352
7	株式会社タケダレース	131	158	365	263	329
8	三菱電機株式会社	368	424	304	286	272
9	新日軽株式会社	90	91	119	141	260
10	アロン化成株式会社	183	218	235	265	250

3. 2005 年における商標登録出願件数上位 10 社の出願件数推移

		2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
1	花王株式会社	519	535	459	529	1,054
2	明治製菓株式会社	282	444	548	488	590
3	ロート製菓株式会社	195	296	286	392	565
4	株式会社資生堂	477	497	548	576	481
5	株式会社コーセー	525	574	382	391	478
6	日本電気株式会社	461	421	422	376	420
7	株式会社タカラトミー	269	323	316	278	383
8	日本郵政公社	0	118	297	124	350
9	江崎グリコ株式会社	586	522	360	414	335
10	カネボウ株式会社	950	823	804	288	302

